

2004年11月吉日

お客様各位

ステラ ケミファ株式会社
営業部（大阪・東京）

セミコン2004 出展のご案内

拝啓 紅葉の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、12月1日(水)～3日(金)に幕張メッセにて開催されます「セミコン・ジャパン2004」に本年も出展を致します。

出展内容としましては半導体用薬品をはじめ、耐腐食表面処理技術、WF6，BF3等のフッ素系ガスについてのご紹介を予定しております。

弊社製品に関する技術セミナーを下記の要領にて弊社ブースで実施致します。

また、弊社の最新版製品カタログもご用意しております。

会場にいられた際には、是非とも弊社ブースまでお立ち寄りいただきたく、お願い申し上げます。

敬具

記

セミナー内容【場所 弊社ブース（8A-1113：ホール8の南口近く）】

時間	12月1日(水)	12月2日(木)	12月3日(金)
10:30 ～10:45 (15分)	セミナー① 微細加工を支えるHF/BHF技術 ～Part1～	セミナー① 微細加工を支えるHF/BHF技術 ～Part1～	セミナー① 微細加工を支えるHF/BHF技術 ～Part1～
11:30 ～11:45 (15分)	セミナー② 微細加工を支えるHF/BHF技術 ～Part2～	セミナー② 微細加工を支えるHF/BHF技術 ～Part2～	セミナー② 微細加工を支えるHF/BHF技術 ～Part2～
13:30 ～13:45 (15分)	セミナー③ フッ化水素酸が出来るまで ～ 蛍石について ～	セミナー③ フッ化水素酸が出来るまで ～ 蛍石について ～	セミナー③ フッ化水素酸が出来るまで ～ 蛍石について ～
14:30 ～14:45 (15分)	セミナー④ 新表面改質への挑戦！ フッ化処理の新技術の可能性 ～Part1～	セミナー④ 新表面改質への挑戦！ フッ化処理の新技術の可能性 ～Part1～	セミナー④ 新表面改質への挑戦！ フッ化処理の新技術の可能性 ～Part1～
15:30 ～15:45 (15分)	セミナー⑤ 新表面改質への挑戦！ フッ化処理の新技術の可能性 ～Part2～	セミナー⑤ 新表面改質への挑戦！ フッ化処理の新技術の可能性 ～Part2～	セミナー⑤ 新表面改質への挑戦！ フッ化処理の新技術の可能性 ～Part2～

以上